氦离子显微镜对钨中氦行为的实验研究*

马玉田^{1)†} 刘俊标¹⁾⁴⁾ 韩立¹⁾⁴⁾ 田利丰²⁾ 王学聪²⁾ 孟祥敏²⁾⁴⁾ 肖善曲³⁾ 王波³⁾

(中国科学院电工研究所,北京 100190)
(中国科学院理化技术研究所,北京 100190)
(北京工业大学材料科学与工程学院,北京 100124)
(中国科学院大学,北京 100049)
(2018 年 10 月 17 日收到; 2018 年 12 月 12 日收到修改稿)

针对热核聚变面向等离子体钨材料中氦泡形成、演变以及机理研究的需求,克服目前常用离子注入、电子扫描显微镜和透射电子显微镜等离线研究手段存在的不足,提出氦离子显微镜对钨中氦的上述行为原位 实时在线研究方法.借助氦离子显微镜的离子注入、显微成像和聚焦离子束纳米加工功能,它可以提供能量 为0.5—35 keV、束流密度可达10²⁵ ions/(m²·s)以上的氦离子束,在该设备上进行钨中氦的注入实验.同时在 注入过程,实时在线监测钨中氦泡形成、演变过程以及钨材料表面形貌的变化,原位在线分析钨材料表面氦 泡的大小、迁移合并以及其诱发的钨表面和近表面的微观损伤.实验结果表明:氦离子显微镜是研究钨中氦 行为演变过程及其微观机理研究的新的研究手段和强有力的实验工具.

关键词: 钨, 氦行为, 氦离子显微镜, 实时原位分析 **PACS**: 07.78.+s, 52.40.-w, 61.80.-x, 61.80.Jh

DOI: 10.7498/aps.68.20181864

1 引 言

众所周知,核聚变能是未来潜在的清洁安全能 源,可控热核聚变装置托卡马克以及未来反应堆中 关键材料问题的解决将是决定聚变能源能否成功 应用的关键之一^[1].钨(W)由于具有高的熔点、良 好的导热性和低溅射产额等优点而作为重要的面 向等离子体材料 (plasma-facing material, PFM) 的候选材料之一^[2].聚变反应中产生的氢(H)氦 (He)等离子体将与 PFM 发生相互作用,从而导致 材料性能恶化,如起泡和脆化等,这将严重影响聚 变等离子体的稳定性并降低 PFM 的使用寿命^[3]. 其中 He 致 W 起泡及脆化问题是制约 W 作为 W 中 He 行为的研究主要通过两种途径, 一是 托卡马克装置实验, 在国际热核聚变堆 (international thermonuclear experimental reactor, ITER) 运行的实际环境下研究等离子体与壁材料的复杂 综合相互作用; 二是实验模拟, 主要的实验模拟装 置有直线等离子体发生装置和离子注入机等, 在模 拟 ITER 运行环境中单一或者简单综合条件下研 究等离子体与壁材料的相互作用. 但是, 现有托卡 马克以验证聚变反应高效运行为主, 时间和成本上 难以兼顾材料测试研究. 而实验室规模上的实验 模拟和数值模拟相结合, 为聚变堆材料的研发和测

PFM 候选材料应用的重要方面, He 引入 W 中后 诱发的 W 微观结构及性能的变化是导致 He 脆的 根本.因此,有必要对 W 中微观 He 行为进行研究.

^{*} 国家自然科学基金 (批准号: 11775228, 51571003) 资助的课题.

[†] 通信作者. E-mail: myt@mail.iee.ac.cn

^{© 2019} 中国物理学会 Chinese Physical Society

试提供了低成本、高效率、条件灵活的实验平台, 已成为聚变堆材料研究与测试不可或缺的研究手 段. 目前大多数实验模拟采用加速器和离子注入机 来进行实验模拟,这类设备提供的束流一般在 <10¹⁸ ions/m²·s 以下,由于 ITER 热核聚变堆中等 离子体的束流一般在 10¹⁸ ions/m²·s 以上, 能量在 1 eV 到几十 keV. 加速器和离子注入机无法模拟 ITER 热核聚变堆大束流稳定运行的实际环境.利用上述 实验设备, W中He行为的研究主要进行了在不同 能量 (eV-MeV)、不同温度 (300-2600 K)、不同 剂量 (10²⁰—10²⁷ ions/m²) 条件下的一系列的辐照 实验研究[4],并得到离子的能量、注入剂量、剂量 率、靶的温度以及晶体取向都会影响W中He行 为, He 辐照下 W 中产生各种类型的缺陷, 如间隙 原子、空位、位错环、空洞、He泡、"fuzz"等^[5-9]. 扫 描电子显微镜 (scanning electron microscope, SEM) 和透射电子显微镜 (transmission electron microscope, TEM) 是 He 辐照后诱发的 W 近表面微观 结构及性能变化的主要研究手段,用来直接观测 He泡的形态大小、密度、分布以及其形成机理的分 析.采用该研究手段结合计算模拟方法得出了 He 辐照下 W 表面起泡行为的规律和机理的主流 观点: He 注入钨中后被其诱发的缺陷捕获, 导致 He 在缺陷处的大量聚集, 形成过饱和状态, 从而形 成一定的局域应力,当局域应力过大时材料会发生 相应的塑性变形,进而形成 He 泡,孔洞等辐照损 伤^[10-12]. 但是由于不同辐照缺陷和 He 之间的相关 作用十分复杂,现在对于 He 注入下 W 表面起泡 行为的规律和机理并没有完全一致的理论. 目前研 究设备、手段以及方法还不能直接观测到 He 泡的 形成及演化,而且 TEM 由于其透射样品的体积不 会超过 1 mm³,其统计性存在局限性,因此,亟待 新研究手段和方法用来研究 W 中微观 He 行为, 以期弄清 W 中 He 行为的规律及其机理.

本工作首先介绍氦离子显微镜 (helium ion microscope, HIM) 的工作原理和独特性能;其次 在 HIM 上进行 W 中 He 的注入,并借助 HIM 对 注入过程中 W 的表面形貌的变化进行监测;最后 借助 HIM 对 W 中 He 注入诱发的表面和近表面 的微观损伤进行原位在线分析, 期望 HIM 有助于 进一步对 W 中微观 He 行为的认识.

2 HIM 的工作原理及性能

2.1 工作原理

HIM 的组成部件与 SEM 很类似, HIM 的整体结构如图 1 所示, 主要由离子光学系统、信号收集及显示系统、真空系统和电源系统^[13].离子光学系统是由离子源、电磁透镜、扫描线圈和样品室等部件组成, 其作用是用来获得扫描离子束, 作为信号的激发源.为了获得较高的信号强度和图像分辨率, 扫描离子束应具有较高的亮度和尽可能小的束斑直径, 这是与 SEM 电子光学系统不同之处.信号收集系统由电子探测器和离子探测器组成, 检测样品在入射离子作用下产生的二次电子信号和被散射离子信号, 然后经视频放大作为显像系统的调制信号.真空系统的作用是为保证离子光学系统正常工作, 一般情况下要求保持 10⁻⁸ Pa 的真空度.



Fig. 1. Schematic diagram and working principle diagram of HIM: (a) Schematic diagram; (b) working principle diagram.

电源系统由稳压, 稳流及相应的安全保护电路所组成, 其作用是提供 HIM 各部分所需的电源.

HIM 是在场离子显微镜 (field ion microscope, FIM) 基础上发展起来, 以曲率 10—100 nm 的单晶钨作针尖, 以氦 (He)(或氢 (H)、或氖 (Ne) 和氩 (Ar) 等惰性气体) 为成像气体, 其工作原理如 图 1 所示^[13]. 具体为: 液氮冷却的单晶钨丝针尖, 被放置在几百 Pa 低压的氦气氛围内; 氦原子被吸 附在冷钨丝上; 钨丝上有一定的高压, 尖端 3 个钨 原子上所吸附的氦原子会被电离激发成离子, 形 成 3 个不同方向的离子束流; 选择其中一束离子束 流, 进行加速、聚焦, 用于扫描样品并捕获其二次 电子、背散射离子图像, 从而获得样品信息, 同时 也实现对样品的刻蚀.

2.2 工作性能

HIM 不仅具有 SEM 的显微成像功能,还具有 聚焦离子束 (focused ion beam, FIB)的纳米加工 功能和离子注入机 (ion implanter)的离子注入功 能. HIM 可以实现高效、高精度的亚 10 nm 级结 构的加工,是唯一的集 Ga、Ne、He 三种离子束为 一体的成像加工平台,覆盖了微米到纳米尺度的成 像与加工应用^[14,15]. 与 SEM、FIB 和 ion implanter 相比, HIM 具有以下几个方面的独特性能和优势.

1) 超高分辨率显微能力. HIM 具有分辨率为 < 0.5 nm 超高分辨率, 比 SEM 高一个数量级, 理 论上有可能达到 TEM 观察效果.

2) 超高精度的纳米加工能力. HIM 具有亚 10 nm 加工能力,其精度比 FIB 高 2—5 倍,这种加工能 力可以实现材料表面纳米化,人为地构建出材料表 面纳米图形.

3)低中能大通量的离子注入能力^[16]. HIM 的 加速电压为 0.5—35 kV, He 离子束流强度为 0.1—100 pA,离子束斑直径为 0.5 nm,由通量公 式 $\Phi_{\text{flux}} = \frac{I}{neA}$ (其中, Φ_{flux} 为通量, ions/(m²·s); I为束流强度, C/s; *n* 为每个离子的电荷数; *A* 为 注入面积, m²; *e* 为电子电荷量)可计算得: $\Phi_{\text{flux}} = \frac{I}{neA} = \frac{0.1 \times 10^{-12}}{2 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 3.14 \times (0.5 \times 10^{-9})} = 3.98$ × 10²⁵ ions/(m²·s). 由此可知, HIM 可以提供能量 为 0.5—35 keV、通量可达 10²⁵ He/(m²·s) 的离子 束,比离子注入机提供的通量高出十几个数量级, 比国内直线等离子体发生装置提供的通量也要高 几个数量级.

4) 实时在线监测和原位分析. HIM 在加工和 离子注入过程中能够实时在线监测样品表面信息 且进行原位分析, 这是 SEM、FIB 和 ion implanter 等设备所不具备的独特能力.

3 He离子注入及其过程监测

本文样品是由安泰科技股份有限公司提供的 高纯钨板,采用粉末冶金方法制备的,纯度大于 99.99%, 在 1673 K 下保温 1 h 进行热轧处理 (形 变量为 70%) 制成 3 mm 厚的钨板, 晶粒大小在 20-60 µm,采用线切割从钨板上割成大小为 10 mm × 10 mm × 3 mm 类型的样品,所有样品经 过单面机械抛光,样品表面的粗糙程度小于 0.2 μm. He离子注入是采用 HIM 设备,本底真空度在 He 注入前小于 1 × 10⁻⁸ Pa, 注入时的压强在 0.01 Pa 左右. 注入条件是: 注入能量为 30 keV, 通量约为 6×10^{26} ions/(m²·s), 剂量为 1.0×10^{22} ions/m². 在样品上选取三个不同的晶面交界的区域进行 He离子注入,如图2所示.根据电子背散射衍射 (electron backscattered diffraction, EBSD) 图样, 图 2(a) 中 a₁、a₂、a₃ 三个晶粒的晶体取向分别接 近 (110)、(111) 和 (100), 如 图 2(b) 所示. 样品注





Fig. 2. EBSD map and surface micrograph of tungsten: (a) EBSD map of tungsten; (b) surface micrograph of tungsten; (c) the irradiated area of tungsten.

人区域如图 2(c) 所示, 注入区域为直径 5 μm的 圆面. 对样品表面形貌表征中, 采用大束流的 He离子束对其表面微观形貌分析, 在样品 a₁、a₂、 a₃ 三个晶粒的交界处沉积了一定量的 He 离子, 如 图 2(c) 中方形区域所示, 这对样品该位置等同于 预先注入了 He 离子, 这对本文的实验研究内容没 有影响. 在所有注入过程中, 样品的温度在 300 K 左右.

He 注入过程中样品表面形貌的变化采用 HIM 进行在线监测.整个注入的时间为 2160 s,每 隔 20 s 对 He 注入过程取一幅图进行监测.为了简 化研究,在此每隔 120 s选取一幅图用来分析注入 过程中 W 中 He 泡形成、演变过程以及其诱导的 W 表面形貌变化,如图 3 所示.与图 2(c) 未进行 He 注入的原始形貌对比,在 720 s时在 a₁、a₂、 a₃ 三个晶粒的交界处表面已经起泡,标识为 He 泡 1,如图 3(f) 所示,而其他区域表面平滑没有起泡.这 主要原因在于三个晶粒的交界处在显微形貌分析

中预先注入了 He 离子, 注入剂量达到了起泡阈值, 从而表面起泡. 除三个晶粒的交界处之外的区域, 在 1200 s 时, 注入剂量约为 5.56 × 10²¹ ions/m², 晶体取向接近 (110) 和 (111) 的 a1 和 a2 晶粒表面 已经起少量的泡,如图 3(j) 所示,在两个晶粒表面 分别选取了 He 泡 2 和 He 泡 3 作为单个泡的跟踪 研究. 此时晶体取向接近 (100) 晶粒 a3 表面平滑, 没有出现起泡现象. 这表明 He 泡的形成与晶粒取 向具有很明显的依赖关系. He 泡更容易形成于 (111) 取向的晶粒 a2 表面, 而不容易形成于 (100) 取向的 晶粒 a3 上. 这种晶粒取向依赖关系和文献 [17-21] 中结果是一致的. 当注入时间增加到 1320 s 时, 晶 粒 a3 表面出现了 He 泡, 如图 3(k) 所示, 而且 He泡5破裂.此后随着注入剂量的增大,各个晶体 取向的晶粒表面出现 He 泡增大、破裂现象, 如图 3(k)—(r) 所示. 纵观整个注入过程 W 表面起泡情 况,样品在注入区域内的起泡程度不均匀,各个晶 体取向的晶粒起泡阈值也不一样.



图 3 He 泡生长过程的原位在线监测 (a) 120 s; (b) 240 s; (c) 360 s; (d) 480 s; (e) 600 s; (f) 720 s; (g) 840 s; (h) 960 s; (i) 1080 s; (j) 1200 s; (k) 1320 s; (l) 1440 s; (m) 1560 s; (n) 1680 s; (o) 1800 s; (p) 1920 s; (q) 2040 s; (r) 2160 s

Fig. 3. In-situ observation of helium bubble growth during helium implantation: (a) 120 s; (b) 240 s; (c) 360 s; (d) 480 s; (e) 600 s; (f) 720 s; (g) 840 s; (h) 960 s; (i) 1080 s; (j) 1200 s; (k) 1320 s; (l) 1440 s; (m) 1560 s; (n) 1680 s; (o) 1800 s; (p) 1920 s; (q) 2040 s; (r) 2160 s.

为了进一步研究不同晶体取向的晶粒表面起 泡阈值的差异,选取了He注入过程中不同时间段 的图像,如图4所示,观察除预先注入三个晶粒的 交界处之外区域的表面起泡情况.从图中可以看 出,当注入时间为1100 s 时,晶体取向接近(111) 的 a₂ 晶粒表面没有出现起泡,当注入时间增大 20 s, 注入剂量约为 5.19 × 10²¹ ions/m²,该晶粒表面形 成了明显的 He 泡,如图 4(b) 所示.此时, a₁ 和 a₃ 晶粒表面没有出现起泡现象.当注入时间增加到 1180 s 和 1220 s 时,即注入剂量分别增加到 5.46 × 10^{21} ions/m² 和 5.65 × 10^{21} ions/m²左右, a_1 和 a_3 晶粒表面分别先后出现 He 泡, 分别如图 4(e) 和 (g) 所示. 这与传统多晶钨样品在 keV 能量的 He 离子辐照到剂量大于 10^{21} ions/m² 情况下其表面就

会起泡的结果是一致的^[22].本实验结果表明接近(111)、(110)和(100)晶向的W晶粒的He起泡阈 值中,接近(100)晶向W晶粒的最大,接近(110)晶 向W晶粒的次之,而接近(111)晶向W晶粒的最小.



图 4 He 泡生长过程的在线监测 (a) 1100 s; (b) 1120 s; (c) 1140 s; (d) 1160 s; (e) 1180 s; (f) 1200 s; (g) 1220 s; (h) 1240 s Fig. 4. *In-situ* observation of helium bubble growth during helium implantation: (a) 1100 s; (b) 1120 s; (c) 1140 s; (d) 1160 s; (e) 1180 s; (f) 1200 s; (g) 1220 s; (h) 1240 s.

为了更进一步证实上述结论,针对预先注入三 个晶粒的交界处的表面起泡情况进行分析,选取 了 He 注入过程中不同时间段的图像,如图 5 所示, (111)、(110)和 (100)晶向的 W 晶粒表面随着注 入时间的增加, 先后出现了起泡现象, 分别如图 5(c)、(d)和(f), 尽管注入剂量无法定量分析, 但和 上述(111)、(110)和(100)晶向的W晶粒表面起 泡阈值排序是一致的.



图 5 He泡生长过程的在线监测 (a) 120 s; (b) 240 s; (c) 360 s; (d) 480 s; (e) 600 s; (f) 720 s; (g) 840 s; (h) 960 s Fig. 5. In-situ observation of helium bubble growth during helium implantation: (a) 120 s; (b) 240 s; (c) 360 s; (d) 480 s; (e) 600 s; (f) 720 s; (g) 840 s; (h) 960 s.

目前主要有两个理论对 W 中 He 起泡的晶体 取向性进行了解释. 一种理论^[20]认为, <111>方向 是 W 体心立方晶体间隙最大的方向, 入射粒子更 容易在此方向上进行迁移扩散, 从而容易聚集形 成 He 泡. 另一种理论^[23, 24]认为, <111>是 W 的 低指数滑移系, W 原子在<111>方向上更容易滑 移. 具体哪一种理论更能准确解释这种 He 泡产生 晶体取向性的原因还需要进一步的研究.

HIM 不仅可以实时在线监测 He 注入过程中

样品表面形貌的变化,还可以对单一 He 泡进行跟踪观察分析,如图 3(f)、(j)—(1)所示的 He 泡 1、2、3、4、5和6.对上述 He 泡观察分析,自这些 He 泡 形成后,这些 He 泡的大小和形状没有随着注入剂量的增加而变化.进一步观察分析,这些 He 泡都 已经在泡边缘处开裂,这可能是其不随注入剂量增 加而变化的原因.在一定能量下,He 泡在 W 中起 泡初始阶段随着注入剂量的增加而长大,随着注入 的继续增加,He 泡中聚集的大量 He 会产生相应 的内应力.当 He 泡内应力与表面张力平衡时, He 泡的尺寸就达到极值.当 He 泡内应力足够大时, 在 He 泡的应力集中区域就会发生 He 泡的破裂而 降低 He 泡内部的压强.He 泡破裂后其形貌尺寸 不再发生明显的变化,这是因为其内部因 He 泡的 破裂而失去了 He 泡继续长大和裂纹扩展的动力.

4 He 泡原位分析

当 He 注入到 W 中, 被其 W 诱发的缺陷捕获, 从而发生迁移、聚集成簇,从而形成 He 泡.由于样 品在辐照区域内产生缺陷类型和数量不同,造成 He 起泡程度并不均匀,因而 He 泡尺寸不同.对本 工作的 He 泡尺寸的统计如 图 6(a) 所示, 从图中 可以看出接近 (111)、(110) 和 (100) 晶向的 W 晶 粒的 He 泡尺寸都在 1 µm 以下, 不同晶粒表明起 泡情况以及 He 泡尺寸不同. 大的 He 泡主要分布 接近 (111) 晶向的 W 晶粒中, 小 He 泡分布在接 近 (100) 晶向的 W 晶粒中, 而接近 (110) 晶向的 W 晶粒中既有大 He 泡又有小 He 泡. 根据 He 泡 形成机理, He 在 W 中先形成小 He 泡, 小 He 泡迁 移合并形成 He 泡, 并在 W 表面出现明显的泡状 结构. 在形成大 He 泡之前, 这些小泡在距表面 100 nm 左右的区域内钨中产生了很多小孔洞和裂 纹,如图 6(b)所示.这个剖面是图 6(a)所示的尺 寸为 786 nm 的 He 泡的近表面层损伤情况, 由图 可以看出该 He 泡在近表面层下方约 156 nm 的位 置处形成一道宽度约为 58 nm 的裂纹,并向晶界 处延伸,该裂纹深度和 30 keV He 离子注入深度相 当.这也表明了 He 泡形成与晶体取向有关.

为了进一步研究 He 泡形成与晶界以及晶体取 向相关性,针对图 3(f)、(k)和(l)所示的 He 泡4、 6和1进行 FIB 切割,其横截面分别如图 7(b)— (f)所示. He 泡4包含了接近(111)和(110)晶体 取向的两个晶粒的 He 泡,如图 7(b)所示,这个 He 泡没有跨过晶界,但在这个 He 泡近表面层下 方约为 20 nm 的位置处出现了重叠的 He 注入诱 导的裂纹,这可能是 nm 尺寸的 He 泡破裂造成的. 对 He 泡 6 包含了接近(111)和(100)晶体取向的 两个晶粒的 He 泡,如图 7(c)所示裂纹1和裂纹2, 这两个裂纹也没跨过晶界,但裂纹2 有跨过晶界的 趋势.上述实验结果可以表明小的孔洞合并成了大 的孔洞,合并后的孔洞表面表现出了明显的泡状结 构.这也表明 He 泡的合并在 He 泡的生长过程中 扮演着重要的作用.



图 6 He 泡和裂纹的大小测量 (a)He 泡; (b) 裂纹 Fig. 6. Measurement of the helium bubble and crack size: (a) Helium bubble; (b) crack.



图 7 氦泡横截面微观形貌 Fig. 7. Cross-section of helium bubbles microstructure.

为了进一步研究小 He 泡能否跨过晶界,针对 He 泡 1 观察分析,如图 7(d)—(f) 所示,从图 7(d) 和 (e) 可以看出 He 泡已经跨过晶界, 这两个晶界 分别是接近 (110) 和 (100) 晶体取向以及 (111) 和 (100) 晶体取向的晶界. 当氦泡的扩展遇到晶界时, 其扩展方向发生了改变,裂纹变为沿着晶界方向扩 展. 这可能是因为不同晶界特性对 He 泡的影响不 同所导致的. 裂纹的扩展一般沿着滑移面方向进 行,当裂纹遇到小角度晶界的时候,晶界位错的阻 碍作用不大,裂纹不需要很大程度的改变方向就能 从一个晶界扩展到另一个晶界. 如果裂纹在扩展过 程中遇到了大角度晶界,而且相邻两个晶粒的滑移 面方向差别很大,裂纹的扩展不易通过晶界而扩展 到下一个晶粒中,从而在晶界处产生了很大的内应 力,导致裂纹的沿晶界扩展,如图 7(f)所示,这个 晶界是接近 (110) 和 (111) 晶体取向的晶界. 这个 实验结果的理论分析还需要进一步的实验研究.

5 结 论

在 HIM 上进行 W 中 He 的注入, 对 He 注入 过程中 W 表面形貌的变化进行实时在线监测, 探 索 He 泡的形成过程, 揭示了 He 起泡具有晶体取 向性. 通过对 W 表面单个 He 泡进行原位跟踪, 分 析其演变过程, 研究结果表明 He 泡的破裂会失去 了 He 泡继续长大和裂纹扩展的动力. 在 He 注入 完成后, 原位在线分析 W 中 He 注入诱发的表面 和近表面的微观损伤, 实验观察到了 He 泡因合并 对近表面造成开裂等损伤, 在一定条件下 He 泡能 够跨过晶界的进行扩展. 通过本文实验研究, 解决 了 目前采用加速器和离子注入机和 SEM 以及 TEM 离线实验研究 W 中 He 行为的不足, 证实了 HIM 是研究 W 中微观 He 行为强有力新的研究手 段和工具.

参考文献

[1] Bolt H, Barabash V, Federici G, Linke J, Loate A, Roth J,

Sato K 2002 J. Nucl. Mater. 43 307

- [2] Lässer R, Baluc N, Boutard J L, Diegele E, Dudarev S, Möslang A, Pippan R, Riccardi B, Van der Schaaf B 2007 *Fusion Eng. Des.* 82 511
- [3] Wilson W D, Bisson C L, Baskes M L 1981 Phys. Rev. B. 24 5618
- [4] Shahram S, Akiyuki T, Koji N, Nasr G 2009 J. Nucl. Mater. 389 203
- [5] Alimov V K, Wang Y W, Liang T R, Yu Q Z, Jia X J 2017 *Fusion Eng. Des.* **125** 479
- [6] Zhou H B, Li Y H, Lu G H 2016 Comp. Mater. Sci. 112 487
- [7] Chen Z, Han W J, Yu J G, Laszlo K, Zhu K G , Wei Q M 2016 J. Nucl. Mater. 479 418
- [8] Al-Ajlony A, Tripathi J K, Hassanein A 2017 J. Nucl. Mater. 488 1
- [9] Wang L, Hao T, Zhao B L, Zhang T, Fang Q F, Liu C S, Wang X P, Cao L 2018 J. Nucl. Mater. 508 107
- [10] Chen Z, Niu L L, Wang Z L, Tian L F, Laszlo K, Zhu K G, Wei Q M 2018 Acta Materialia 147 100
- [11] Nishijima D, Ye M.Y, Ohno N 2004 J. Nucl. Mater. 329—333 1029
- [12] Yang X, Hassanein A 2013 J. Nucl. Mater. 434 1
- [13] Ananth M, Scipioni L , Notte J 2008 Am. Lab. 40 42
- [14] Economou N P, Notte J A, Thompson W B 2011 Scanning 33 1
- [15] Hlawacek G, Veligura V, Van Gastel R, Poelsema B 2014 J. Vac. Sci. Technol. B 32 020801
- [16] Bergner F, Heintze C 2018 J. Nucl. Mater. 505 267
- [17] Hasenhuetl E, Zhang Z X, Kiyohiro Y, Peng S, Akihiko K 2017 Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B 397 11
- [18] Valles G, Panizo-Laiz M, Gonz_alez C, Martin-Bragado I, Gonz_alez-Arrabal R, Gordillo N, Iglesias R, Guerrero C L, Perlado J M 2017 Fusion Eng. Des. 125 479
- [19] Fukumoto M, Kashiwagi H, Ohtsuka Y, Ueda Y, Nobuta Y, Yagyu J, Arai T, Taniguchi M, Inoue T, Sakamoto K 2009 J. Nucl. Mater. 386-388 768
- [20] Miyamoto M, Mikami S, Nagashima H, Iijima N, Nishijima D, Doerner R P, Yoshida N, Watanabe H , Ueda Y, Sagara A 2015 J. Nucl. Mater. 463 333
- [21] Liu F S, Rui H T, Peng S X, Zhu K G 2014 Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B 333 120
- [22] Gilliam S B, Gidcumb S M, Forsythe D 2005 Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B 241 491
- [23] Lindig S, Balden M, Kh Alimov V 2009 Phys. Scripta T 138 014040
- [24] Smirnov R D, Krasheninnikov S I, Guterl J 2015 J. Nucl. Mater. 463 359

Helium behavior of tungsten investigated by helium ion microscope^{*}

1) (Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

2) (Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

3) (College of Materials Science and Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China)

4) (University Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

(Received 17 October 2018; revised manuscript received 12 December 2018)

Abstract

Nuclear fusion energy is a clean and safe energy resource with huge potential. Tungsten is the primary candidate for plasma facing materials (PFMs) in future nuclear reactors because of its high melting point, high thermal conductivity and high resistance to sputtering and erosion. However, the interaction between tungsten and helium plasma generated by deuterium-tritium nuclear reactions will result in the degeneration of tungsten through helium blistering in tungsten. The solubility of helium in tungsten is low, and it tends to aggregate at grain boundary, phase boundary, vacancies and dislocations, thus forming helium bubbles. These bubbles will lead to microstructure changes of surface and bulk phases, as well as a decrease in mechanical properties, which seriously affects the service life of material. Limited by experimental techniques, some basic problems for the growth of helium bubbles in tungsten are not clear, for instance, how the helium clusters migrate, and nucleation mechanisms. The study of complex helium bubble formation, evolution and its underlying mechanism in tungsten PFM necessitates advanced experimental techniques. Traditional methods such as ion implantation, scanning electron microscope and transmission electron microscope are inadequate for this task. Therefore, we propose the helium ion microscope method to investigate the aforementioned several aspects of helium in tungsten in situ and real-time. Here, a helium irradiation experiment is performed by helium ion microscope (HIM), featuring nanostructure fabrication, ion implantation and microscopic imaging. The HIM can generate an ion beam with energy in a range of 0.5-35 keV and an flux upto 10^{25} ions/m²/s. In the process of helium ion implantation, we observe in situ and real time the helium blistering and the morphological evolution on tungsten surface, in order to capture the helium implantation-induced microscopic damage evolution on tungsten surface and subsurface. From the results of in situ HIM experiments, it is believed that a strong orientation dependence of blistering is observed with the blister occurring preferentially on the surface of grains with normal direction close to (111), and surface blistering of tungsten is directly related to cracks immediately below the surface. The present study demonstrates that the HIM is a powerful tool for investigating the helium blistering behavior in tungsten and provides valuable experimental data and reference for designing PFMs.

Keywords: tungsten, helium behavior, helium ion microscope, real-time analysis of in situ

PACS: 07.78.+s, 52.40.-w, 61.80.-x, 61.80.Jh

DOI: 10.7498/aps.68.20181864

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 11775228, 51571003).

[†] Corresponding author. E-mail: myt@mail.iee.ac.cn